

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 9 月 22 日 (2005.9.22)

【公開番号】特開 2004-240457(P2004-240457A)
 【公開日】平成 16 年 8 月 26 日 (2004.8.26)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-033
 【出願番号】特願 2004-137868(P2004-137868)
 【国際特許分類第 7 版】

G 0 2 B 5/20
 G 0 2 F 1/1335

【F I】

G 0 2 B 5/20 1 0 1
 G 0 2 F 1/1335 5 0 5
 G 0 2 F 1/1335 5 2 0

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 6 月 13 日 (2005.6.13)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

対向して配置された第 1 及び第 2 の基板間に電気光学物質が挟持され、前記第 1 の基板には反射層が形成され、一つの画素内には透過部と、前記反射層に対応した反射部と、が個別に設けられ、前記一つの画素内に淡色部と当該淡色部よりも光濃度が高い濃色部とを有する着色層を備えた電気光学装置であって、

前記反射部には前記着色層の淡色部が配置されるとともに前記一つの画素内で前記反射層が形成されていない前記透過部には前記着色層の前記濃色部が配置されてなり、前記着色層上には前記反射部における前記電気光学物質の厚みを前記前記透過部における前記電気光学物質の厚みより薄くする保護層が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 2】

前記第 1 の基板と前記反射層との間には、表面に凹凸パターンを有する下地層が形成され、前記反射層の反射面には前記凹凸パターンに対応した凹凸が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】

対向して配置された第 1 及び第 2 の基板間に電気光学装置が挟持され、前記第 1 の基板には反射層が形成され、一つの画素内には透過部と、前記反射層に対応した反射部と、が個別に設けられ、前記一つの画素内に淡色部と当該淡色部よりも光濃度が高い濃色部とを有する着色層を備えた電気光学装置の製造方法であって、

前記第 1 の基板上に前記一つの画素内の反射部に前記反射層を形成する工程と、

前記反射層上に前記着色層の前記淡色部を形成する工程と、

前記第 1 の基板上の前記反射層が形成されていない前記透過部に前記着色層の前記濃色部を形成する工程と、

前記着色層上に前記反射部における前記電気光学物質の厚みを前記前記透過部における前記電気光学物質の厚みより薄くする保護層を形成する工程と、

を有することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 4】

前記反射層を形成する工程の前に前記第 1 の基板上に表面に凹凸パターンを有する下地層を形成する工程を有することを特徴とする請求項 3 に記載の電気光学装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

上記課題を解決するために本発明の電気光学装置は、対向して配置された第 1 及び第 2 の基板間に電気光学物質が挟持され、前記第 1 の基板には反射層が形成され、一つの画素内には透過部と、前記反射層に対応した反射部と、が個別に設けられ、前記一つの画素内に淡色部と当該淡色部よりも光濃度が高い濃色部とを有する着色層を備えた電気光学装置であって、前記反射部には前記着色層の淡色部が配置されるとともに前記一つの画素内で前記反射層が形成されていない前記透過部には前記着色層の前記濃色部が配置されてなり、前記着色層上には前記反射部における前記電気光学物質の厚みを前記前記透過部における前記電気光学物質の厚みより薄くする保護層が形成されていることを特徴とする。

また、上記において、前記第 1 の基板と前記反射層との間には、表面に凹凸パターンを有する下地層が形成され、前記反射層の反射面には前記凹凸パターンに対応した凹凸が形成されていることを特徴とする。

また、本発明の電気光学装置の製造方法は、対向して配置された第 1 及び第 2 の基板間に電気光学装置が挟持され、前記第 1 の基板には反射層が形成され、一つの画素内には透過部と、前記反射層に対応した反射部と、が個別に設けられ、前記一つの画素内に淡色部と当該淡色部よりも光濃度が高い濃色部とを有する着色層を備えた電気光学装置の製造方法であって、前記第 1 の基板上に前記一つの画素内の反射部に前記反射層を形成する工程と、前記反射層上に前記着色層の前記淡色部を形成する工程と、前記第 1 の基板上の前記反射層が形成されていない前記透過部に前記着色層の前記濃色部を形成する工程と、前記着色層上に前記反射部における前記電気光学物質の厚みを前記前記透過部における前記電気光学物質の厚みより薄くする保護層を形成する工程と、を有することを特徴とする。

また、上記において、前記反射層を形成する工程の前に前記第 1 の基板上に表面に凹凸パターンを有する下地層を形成する工程を有することを特徴とする。

カラーフィルタ基板は、基板と、前記基板に配置され、且つ淡色部および前記淡色部よりも光濃度が高い濃色部を有する着色層と、前記基板上に配置され、且つ実質的に光が透過可能な透過部を有する反射層とを備え、前記濃色部は少なくとも前記透過部に平面的に重なるように配置されている。